(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出題公開番号

特開平5-159394

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51)Int.CL*

的別記号 庁内盛理番号 FΙ

技術表示箇所

G11B 11/10 7/26 A 9075-5D 7215-5D

容査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出頗番号

特類平3-341938

(22)出願日

平成3年(1991)11月30日

(71)出題人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 中野 淳

東京都品川区北品川6丁目5番6号 ソニ

ー・マグネ・プロダクツ株式会社内

(72)発明者 姉崎 芳和

東京都品川区北品川 6丁目 5番 6号 ソニ

ー・マグネ・プロダクツ株式会社内

(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54)【発明の名称】 光ディスクの製造方法

(57)【要約】

【楠成】 記録部上に紫外線硬化樹脂層を形成するに際 し、記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコート法により 塗布した後、ディスクを回転させながら塗布された紫外 線硬化樹脂に紫外線を照射して紫外線硬化樹脂層を形成 する.

【効果】 平坦部が広い紫外線硬化樹脂層が形成でき、 光磁気ディスクとして摺接記録方式を採用した場合にも ユーザエリアを広く採ることが可能な光ディスクが製造 できる.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に形成された光学的に情報の 記録及び/又は再生が可能な記録部上に、紫外線硬化樹 脂層を形成するに際し、

記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコート法により塗布 した後、透明基板を回転させながら塗布された紫外線硬 化樹脂に紫外線を照射して紫外線硬化樹脂層を形成する ことを特徴とする光ディスクの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光ディスクの製造方法に 関し、特に紫外硬化樹脂層の形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、レーザ光の照射により情報の記録 ・再生を行う光ディスクとしては、光磁気ディスク、各 種追記型光ディスク、書換え可能光ディスク、デジダル ・オーディオ・ディスク (いわゆるコンパクトディス ク),光学式ビデオディスク(いわゆるレーザディス ク)等の各種媒体が知られている。

【0003】このうち、光磁気ディスクは、磁性薄膜を 20 部分的にキュリー点または温度補償点を越えて昇温し、 この部分の保磁力を消滅させて外部から印加される記録 磁界の方向に磁化の向きを反転することを基本原理とす るもので、光ファイルシステムやコンピュータの外部記 憶装置、あるいは音響、映像情報の記録装置等において 実用化されつつある.

【0004】このような光磁気ディスクは、たとえば、 ポリカーボネート等からなる透明基板の一主面に、膜面 と垂直方向に磁化容易強を有し、且つ磁気光学効果の大 きな記録磁性層(例えば希土類-遷移金属合金非晶質薄 30 膜) や反射層、誘電体層を積層することにより記録部を 形成し、さらに記録部上の狃う如く紫外線硬化樹脂層を 形成した構成とされる。

【0005】上記橋成の光磁気ディスクに記録を行うに は、透明基板関からレーザ光を照射することにより記録 磁性層の微小面積の領域のみをキュリー温度以上に加熱 するとともに、この領域に紫外線硬化樹脂層関から磁界 を印加する。すると、上記レーザビームが照射された領 域の記録磁性層は保磁力を失い、磁化方向が外部より印 加された磁界方向に做わされ、信号が書き込まれること 40 となる。

【0006】したがって、上記光磁気ディスクに対して 記録再生を行う記録再生装置は、たとえば光磁気ディス クを保持して回転操作する回転駆動装置とレーザ光を照 射する光学ピックアップ装置と磁界を印加する磁気へッ ドとを備えてなり、磁気ヘッドと光学ピックアップ装置 とが光磁気ディスクを介して、磁気ヘッドが紫外線硬化 樹脂層側、光学ピックアップ装置が透明基板側となるよ うに対向配置された構成とされる。

る磁気ヘッドには、サーボ機構が内蔵され、このサーボ **模様により、磁気ヘッドと光磁気ディスクの距離が常に** 一定に保たれるようになされている。ところが、このよ うなサーボ根柄の設置は装置の製造工程の煩雑化、製造 コストの増大を招く。そこで、近年、磁気ヘッドのサー ボ根梢を不要とすることができる記録方式として、磁気 ヘッドが光磁気ディスクのディスク面に接触した状態で 磁界を印加する摺接記録方式が実用化へ向けて開発が進 められており、たとえば小径の光磁気ディスク(いわゆ 10 るミニディスク)の記録方式として採用が検討されてい る.

2

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 摺接記録方式では、上述の如く磁気ヘッドが光磁気ディ スクのディスク面を摺接することとなる。このため、使 用する光磁気ディスクとしては、磁気ヘッドが摺接する 面が潤滑剤等が塗布されることにより、動摩擦係数が低 減されているとともに平坦な面に形成されていることが 良好な記録再生特性を得るための必須条件となる。

【0009】光磁気ディスクにおいて、磁気ヘッドが摺 接する個の面となる紫外線硬化樹脂層は、通常、生産 性、再現性が得られることから、スピンコート法により 形成される。すなわち、記録部の中央部に所定量の紫外 **橡硬化樹脂を滴下した後、ディスクをたとえば4500** rpmで所定時間回転させることにより、滴下した紫外 **換硬化樹脂を記録部全面に均一に行き亘らせる。そし** て、ディスクを止めて2~3秒経過した後、塗布された 紫外線硬化樹脂に紫外線を照射することにより、紫外線 硬化樹脂層を形成する。

【0010】ところが、このようにして形成された紫外 機硬化樹脂層は、外周から2mmに亘る領域に20~3 0μmの盛り上がりを有する形状で形成されてしまう。 光磁気ディスクにおいては、透明基板自体も若干外周付 近が盛り上がっている(約10µmの盛り上がり)形状 を有しているため、外周付近は他の部分と比べて30~ 40μm高い高さを有することとなる。

【0011】光磁気ディスクにおいて、磁気ヘッドが盛 り上がり部分に摺接すると、ディスクが高周波数で振動 し、光学ピックアップ装置のフォーカスサーボやトラッ キングサーボが効かなくなるといった問題を生ずる。こ のため、このようにして紫外線硬化樹脂層が形成された 光磁気ディスクを摺接記録方式の媒体として使用する場 合には、外周から2mmに亘る領域に磁気ヘッドが摺接 しないように、ユーザエリアを狭くすることが必要とな り、十分な信号記録量が得られない。特に、直径64m m程度のミニディスクにおいて、外周から2mmにも亘 る領域が磁気ヘッド非摺接部となってしまうと、ユーザ エリアが狭くなりすぎて、記録情報量の点で実用性に欠 けるものとなってしまう.

【0007】従来、上記記録再生装置において備えられ 50 【0012】そこで、本発明はこのような従来の実情に

鑑みて提案されたものであり、盛り上がり部分の面積が 狭い紫外線硬化樹脂層が形成でき、たとえば光磁気ディ スクとして摺接記録方式を採用した場合でもユーザエリ アを広く採ることが可能な光ディスクの製造方法を提供 することを目的とする.

[0013]

【認題を解決するための手段】上述の目的を達成するた めに、本発明の光ディスクの製造方法は、透明基板上に 形成された光学的に情報の記録及び/又は再生が可能な 記録部上に、紫外線硬化樹脂層を形成するに際し、記録 10 に亘る広い領域に盛り上がりを有した形状で形成され 部上に紫外線硬化樹脂をスピンコート法により塗布した 後、透明基板を回転させながら塗布された紫外線硬化樹 脂に紫外線を照射して紫外線硬化樹脂層を形成すること を特徴とするものである。

[0014]

【作用】記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコートし、 透明基板を回転させながら紫外線を照射して紫外線硬化 樹脂層を形成すると、盛り上がり部分が狭く、平坦部分 の広い紫外線硬化樹脂層が形成される。

[0015]

【実施例】本発明の好適な実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0016】本実施例は本発明を光磁気ディスクの製造 に適用した例である。本実施例において製造する光磁気 ディスクは、透明基板上に少なくとも記録磁性層よりな る記録部が形成され、上記記録部を覆う如く紫外線硬化 樹脂層が形成されてなるものである。

【0017】記録部が形成される基板としては、ガラ ス、ポリカーボネート、PMMA(ポリメチルメタクリ レート), セラミクス, シリコンウェハ等が使用可能で 30 ある。

【0018】上記記録磁性層としては、この種の媒体に 用いられるものがいずれも使用でき、たとえばTbFe Co非晶質合金膜等の希土類-遷移金属非晶質合金膜等 が挙げられる。希土類一遷移金属非晶質合金膜は、スパ ッタリング、分子線エピキタシー、真空蒸着等の真空薄 膜形成技術により基板上に成膜することができる。ここ で、実用的な磁気光学特性を達成する観点からは、膜厚 を100~10000A程度に選ぶことが望ましい。

【0019】上記紫外線硬化樹脂層は、記録部を衝撃や 外部環境との接触による腐食から保護するために設けら れるものであり、摺動記録方式において磁気ヘッドが摺 動する側の面となるものである。この紫外線硬化樹脂層 は、記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコート法により 塗布した後、紫外線を照射して硬化することにより形成 tha.

【0020】ここで、本発明においては、平坦部分の広 い紫外線硬化樹脂層を形成するために、紫外線硬化樹脂 の塗布、硬化を、記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコ

樹脂に紫外線を照射することにより行うこととする。 【0021】すなわち、スピンコート法とは、ディスク 面の中央に所定量の塗料を適下した後、ディスクを回転 させることにより、記録部全面に紫外線硬化樹脂を均一 に行き亘らせて塗布する方法である。 従来の紫外線硬化 樹脂層の形成方法では、紫外線硬化樹脂をスピンコート した後、ディスクの回転を停止させて2~3秒経過した 後、紫外線照射を行っている。ところが、このようにし て形成された紫外線硬化樹脂層は、外周から1~2mm る。

【0022】すなわち、記録部上にスピンコート法によ り紫外線硬化樹脂を塗布した後、基板の回転を停止させ ると、塗布された紫外線硬化樹脂は、ディスク外周付近 に盛り上がりを有している。そして、この盛り上がり部 分の樹脂は時間の経過に伴って徐々に中心へ向かって流 動する。たとえば、紫外線硬化樹脂を振り切り回転数4 500rpm, 振り切り時間4.5秒に設定してスピン コートした場合、盛り上がり部分の紫外線硬化樹脂は、 ディスク回転停止から2秒経過後には、外間から1mm の領域に、また1分経過後には外周から2mmの領域に まで流動する。

【0023】図2、図3に基板1上に紫外線硬化樹脂を スピンコートした後、回転停止から2秒後に紫外線を照 射して形成された紫外線硬化樹脂層2の形状(図2)、 回転停止から1分後に紫外線を照射して形成された紫外 換硬化樹脂園2の形状(図3)を示すが、この状態で紫 外線硬化樹脂に紫外線を照射すると、このようにそれぞ **れ外周付近に幅Dが1~2mm, 高さhが20~30μ** mの盛り上がり2aを有する紫外線硬化樹脂層が形成さ れることとなる.

【0024】光磁気ディスクにおいて、摺動記録方式を 採用する場合、盛り上がり部分にヘッドが摺接すると良 好な情報記録を困難となる。このため、このようにして 紫外線硬化樹脂層が形成された光磁気ディスクは、外周 から1~2mmに亘る領域に磁気ヘッドが接触しないよ うにユーザエリアを設定せざるを得ず、記録情報量の確 保が困難である。特に、ミニディスクとする場合には、 記録情報量において実用性を欠くものとなってしまう。 【0025】本発明では、紫外線硬化樹脂をスピンコー トした後、ディスクの回転を停止させずに引き続きディ スクを回転させながら葉外線を照射して紫外線硬化樹脂 層を形成する.ディスクを回転させながら紫外線照射し た場合には、紫外線照射時において、外周付近の紫外線 硬化樹脂はディスクの回転による遠心力によって、中心 部への流動が抑えられる。このため、盛り上がりは外周 から0.2mm程度の範囲に止まり、形成された紫外線 硬化樹脂層は平坦部の広いものとなる。したがって、摺 動記録方式を採用した場合でも、ユーザエリアを広く採 ートし、ディスクを回転させながら塗布した柴外線硬化 50 ることができ、ミニディスクとした場合でも十分な記録

情報量を得ることが可能な光磁気ディスクが得られることとなる。

【0026】ここで、良好な形状を有する紫外線硬化樹脂層を形成するためには、紫外線照射の際のディスクの回転数R2は、スピンコートの際の振り切り回転数R1よりも小さいことが好ましい。R2がR1よりも大きい場合には、遠心力が大きくなり過ぎ、紫外線硬化樹脂が硬化に際してディスク外周よりもはみ出してしまい、バリが残存する成れがある。

【0027】なお、図1に、R1を4500rpm、R2を3000rpmに設定した場合に形成された紫外線硬化樹脂層2の形状を示すが、このように紫外線硬化樹脂層は、盛り上がり2aの幅Dが0.2mmであり、平坦部が広く、良好な形状を有して形成される。

【0028】上記紫外線硬化樹脂としては、防水性に優れ、紫外線硬化樹脂層として形成した場合にレーザ光を十分に透過し得ることが要求され、アクリル系紫外線硬化樹脂等、通常、使用されている紫外線硬化塗料のうち、これら要求を満たすものを使用することが望ましい。また、紫外線硬化樹脂の粘度および表面張力は、形成される紫外線硬化樹脂層の膜厚や塗布状態に影響するので、紫外線硬化樹脂を選択する場合には、このような点を考慮することが望ましい。本実施例では、粘度500cps,表面張力39dyne/cmの紫外線硬化樹脂を使用した。

【0029】本発明の製造方法において製造される光磁 気ディスクとしては、記録部が上記記録磁性層とともに 誘環体層や反射層等よりなるものであってもよい。

【0030】上記誘電体層は、耐蝕性の向上や多重反射によるカー回転角の増大(カー効果エンハンスメント)を目的として設けられるものであり、酸化物、窒化物、オキシナイトライド等の材料を真空薄膜形成技術により5~5000人の膜厚に成膜することにより得られる。この誘電体膜は、基板と記録磁性層の間に介在させても、記録磁性層の上に積層しても、あるいはその両方で

あっても良い。

【0031】上記反射膜は、記録磁性層を透過したレーザ光をも反射させることによりカー効果にファラデー効果を相乗させ、回転角を拡大するために設けられるものである。通常、A1, Au, Pt, Cu等の金属材料を真空薄膜形成技術にて成膜することにより得られる。

6

場合には、遠心力が大きくなり過ぎ、紫外線硬化樹脂が 【0032】なお、本実施例では、本発明を光磁気ディ 硬化に際してディスク外周よりもはみ出してしまい、バ スクの製造に適用した例について説明したが、本発明は これに限らず、各種追記型光ディスク、コンパクトディ 【0027】なお、図1に、R1を4500rpm、R 10 スク、レーザディスク等各種光ディスクについても適用 を3000rpmに設定した場合に形成された紫外線 可能である。

[0033]

【発明の効果】上述の説明からも明らかなように、本発明の光ディスクの製造方法は、記録部上に紫外線硬化樹脂をスピンコート法により塗布した後、透明基板を回転させながら塗布された紫外線硬化樹脂に紫外線を照射して紫外線硬化樹脂層を形成するので、盛り上がり部分が狭く、平坦部分の広い紫外線硬化樹脂層を形成することができる。

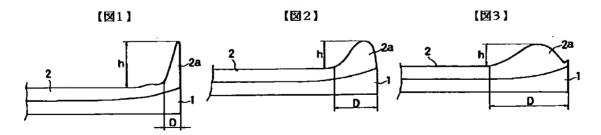
20 【0034】したがって、本発明によれば、たとえば光 磁気ディスクとして摺動記録方式を採用した場合でもユ ーザエリアを広く採ることが可能となり、ミニディスク として好適な光ディスクを得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の方法を適用して形成された紫外線硬 化樹脂層の形状を示す要部機略断面図である。

【図2】 紫外線硬化樹脂をスピンコートした後、ディスクの回転を停止させてから2秒経過後に紫外線を照射して形成された紫外線硬化樹脂層の形状を示す要部機略30 断面図である。

【図3】 紫外線硬化樹脂をスピンコートした後、ディスクの回転を停止させてから1分経過後に紫外線を照射して形成された紫外線硬化樹脂層の形状を示す要部機略断面図である。



PAT-NO: JP405159394A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05159394 A

TITLE: PRODUCTION OF OPTICAL DISK

PUBN-DATE: June 25, 1993

INVENTOR-INFORMATION: NAME NAKANO, ATSUSHI ANEZAKI, YOSHIKAZU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY SONY CORP N/A

APPL-NO: JP03341938

APPL-DATE: November 30, 1991

INT-CL (IPC): G11B011/10, G11B007/26

US-CL-CURRENT: 369/283

ABSTRACT:

PURPOSE: To decrease the build-up area range near the outer peripheral part of a disk by coating the surface of the disk with a UV curing resin by a spin coating method, then irradiating a transparent substrate with UV rays while rotating the substrate, thereby forming a UV curing resin layer.

CONSTITUTION: After the transparent substrate 1 is spin coated with the UV curing resin, the coating is irradiated with UV rays while the disk is kept $\frac{1}{2}$

rotated in succession without stopping the rotation of the disk, by which the UV curing resin layer 2 is formed. The UV curing resin in the outer peripheral edge of the disk is suppressed from flowing toward the central part by the centrifugal force generated by the rotation of the disk. The width of the build-up 2a is, therefore, limited within about 0.2mm from the outer periphery and the formed resin layer 2 is widened in a flat part. Then, the wide recording area is obtd. even in the case of adoption of a sliding recording system.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO& Japio